

新学術領域「原子層科学」 原子層作製講習会

日時：平成26年11月7日（金）13:00-19:00

集合場所：東京大学生産技術研究所 C棟2階 笠岡ラウンジ
東京都目黒区駒場4-6-1（井の頭線 駒場東大前駅より徒歩7分）

アクセス案内：<http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/access/access.html>

スケジュール概要：

11月7日（金）

13:00-13:15 参加受付

13:15-13:30 概要説明

13:30-17:00 原子層作製実習

17:00-19:00 ミニ研究会+懇親会

講習内容：

- ・劈開法によるグラフェン, MoS₂, h-BNの作製
- ・光学顕微鏡による単原子層領域の探索

ミニ研究会+懇親会：

自己紹介を兼ねて、参加者の方に1分間程度でご自身の研究内容を簡単に紹介していただきます。
参加者間の交流が主な趣旨です。

添付のフォーマットでPPTを作成して

mlab@iis.u-tokyo.ac.jp（町田研メーリングリスト）へ送付して下さい。

送付締め切り：11/6（木）15:00

懇親会費 2,000円（予定）を徴収させていただきます。

当日の連絡先

03-5452-6158（町田研実験室・居室）

mlab@iis.u-tokyo.ac.jp

担当：

「原子層科学」物性班

東京大学 生産技術研究所 町田友樹

